



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103919643 A

(43) 申请公布日 2014. 07. 16

(21) 申请号 201410139462. 1

(22) 申请日 2014. 04. 01

(71) 申请人 齐文华

地址 100062 北京市东城区东花市北里中区
5号楼5单元201

申请人 侯晚秋
赵睿琪

(72) 发明人 齐文华 侯晚秋 赵睿琪

(51) Int. Cl.

A61F 9/00(2006. 01)

A61N 2/04(2006. 01)

A61N 2/10(2006. 01)

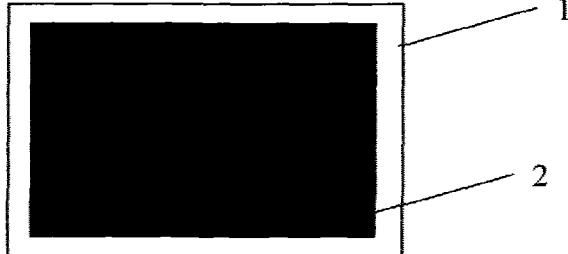
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种抗青光眼手术中所用防术后巩膜瓣粘连的器材

(57) 摘要

本发明公开了一组青光眼手术中所用器材，包括由非生物材料及铸于其内的磁性物质支撑部件构成的植片和包含可调节电流强度及节律的电磁圈的配件。使用本发明，既可以减少青光眼术后巩膜瓣粘连，又能在术后起到眼球按摩的作用，调节术后眼压，可以提高手术远期效果，降低小梁切除术的失败率。



1. 一组青光眼手术中所用器材，其包括植片和含有电磁圈的配件，所述植片由非生物材料及铸于其内的磁性物质支撑部件构成，所述配件所含电磁圈能够调节电流强度及节律。
2. 根据权利要求 1 的器材，其中所述植片为长方形或梯形。
3. 根据权利要求 2 的器材，其中所述植片的长宽小于 4mm×3mm，厚度小于 0.5mm。
4. 根据权利要求 1 的器材，其中所述植片为可固定型或游离型。
5. 根据权利要求 1 的器材，其中所述植片内的磁性物质为金属或磁石薄片。
6. 根据权利要求 1 的器材，其中所述非生物材料为不与眼球壁组织发生粘连或起排异反应的惰性物质。
7. 根据权利要求 1 的器材，其中所述含有电磁圈的配件的形状可与上眼睑保持良好的贴合。

一种抗青光眼手术中所用防术后巩膜瓣粘连的器材

技术领域

[0001] 本发明涉及一种抗青光眼手术中所用防术后巩膜瓣粘连的器材，属于医疗器材领域。

背景技术

[0002] 青光眼是一种不可逆性致盲性眼病，正确治疗可避免眼盲的发生。眼压升高是其主要的危险因素。长期以来，小梁切除术是目前临幊上治疗青光眼最主要的手术方法，手术的目的是控制患者的眼压。

[0003] 在抗青光眼滤过手术中，保持滤过道的通畅是手术成功的关键，而阻塞瘘道外口是手术失败的主要原因。传统的小梁切除术是目前治疗青光眼最普遍应用的较好手术方式，但也存在术后有相当程度的组织反应和瘢痕形成的缺点。尽管目前小梁切除手术的手术方式和术中相关药物、器材已有了很大的发展，但是手术后2年内失败率仍达15%~30%。失败的主要原因与术后滤过通道尤其是巩膜瓣下及巩膜与结膜间瘢痕组织增生有关。

[0004] 青光眼术后常需患者按摩眼球，使眼内房水自滤过通道流出，既可以调节眼压，又可以使房水对滤过通道进行冲刷，减少瘢痕形成。但青光眼患者多没有相关眼科知识，在按摩时不能保证手法和力度的准确，不正确的眼球按摩不但不能达到所需的效果，还可能对眼球造成损伤。

[0005] 因此，需要一种能够在青光眼术后既可以减少术后巩膜瓣粘连，又能对眼球起到按摩效果的器材。

发明内容

[0006] 本发明公开了一组青光眼手术中所用器材，包括由非生物材料及铸于其内的磁性物质支撑部件构成的植片和含有可调节电流强度及节律的电磁圈的配件。

[0007] 使用本发明，既可以减少青光张术后巩膜瓣粘连，又能在术后起到眼球按摩的作用，调节术后眼压，可以提高手术远期效果，降低小梁切除术的失败率。

附图说明

[0008] 图1为植片正视图，其中，1为外部包绕之非生物材料，2为内部磁性物质，植片为长方形或梯形(图中为长方形)，长宽要求小于4mm×3mm。

[0009] 图2植片侧视图，其中，1为外部包绕之非生物材料，2为内部磁性物质，厚度要求小于0.5mm。

具体实施方式

[0010] 根据本发明的手术器材，包括一个内部包含磁性物质、表面由非生物材料包裹的植片，此部分手术中留置于眼球壁巩膜瓣下；及一个含有电磁圈的配件，此部分为术后在眼

球外使用。电磁圈产生的电磁强度及节律均可根据患者所需眼压进行调节。

[0011] 所述植片为长方形或梯形，其长宽小于4mm×3mm，厚度小于0.5mm。植片可根据实际需求设计为可固定型或游离型，植片内包绕的磁性物质可以为金属或磁石薄片，需有足够的磁性，可以和眼球外的电磁圈配件产生足够的吸力；植片外部的材料要求为惰性物质，不与眼球壁组织发生粘连、不会起排异反应，外部 材料要足够薄，仅起到包绕分隔内部磁性物质的作用，且不能影响内部物质的磁性。

[0012] 外部配件的主要部分为一个可以调节电磁强度及节律的电磁圈，其外部结构可以根据实际需要进行设计，要求能与上眼睑保持良好的贴合，电磁圈所在位置正对眼内植片所在部位，可以与眼内植片产生足够的吸引力。

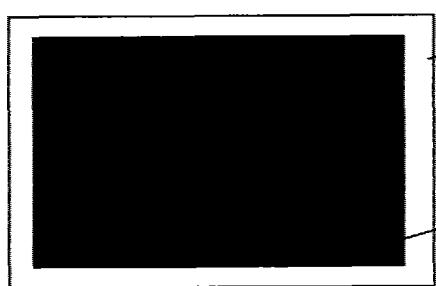


图 1

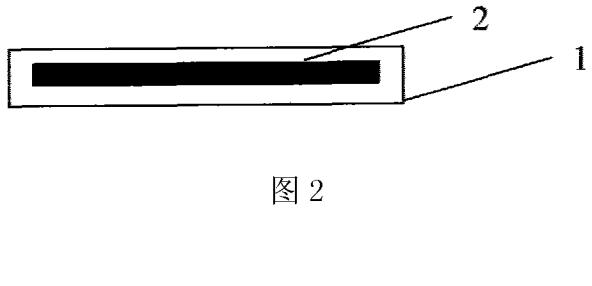


图 2